

Title (en)  
Sample chamber with partition board

Title (de)  
Probenkammer mit Trennplatte

Title (fr)  
Chambre d'analyse dotée d'une plaque de séparation

Publication  
**EP 2604342 A1 20130619 (DE)**

Application  
**EP 11193029 A 20111212**

Priority  
EP 11193029 A 20111212

Abstract (en)  
Sample chamber for microscope investigation, comprises a reservoir for receiving a sample, which is limited by a base plate (2) and a side wall (3), and a separating plate (4), which is parallel to the base plate, is arranged in the reservoir at a height that is less than the minimum height of the side wall such that the separating plate divides the reservoir into an upper partial reservoir (5) and a lower partial reservoir (6). The upper- and the lower partial reservoirs are limited laterally by the side wall, and are connected by the inlet and/or outlet.

Abstract (de)  
Die Erfindung umfasst eine Probenkammer für Mikroskopuntersuchungen umfassend ein Reservoir zum Aufnehmen einer Probe, wobei das Reservoir durch eine Bodenplatte und eine Seitenwand begrenzt wird, und eine im Reservoir angeordnete, zur Bodenplatte parallele Trennplatte, wobei die Trennplatte im Reservoir in einer Höhe angeordnet ist, die geringer als die minimale Höhe der Seitenwandung ist, sodass sie das Reservoir in ein oberes und ein unteres Teilreservoir unterteilt, wobei das untere Teilreservoir und das obere Teilreservoir seitlich vollständig durch die Seitenwandung begrenzt werden, und wobei das obere und das untere Teilreservoir durch wenigstens einen Zu-/Ablauf verbunden sind.

IPC 8 full level  
**B01L 3/00** (2006.01); **C12M 1/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B01L 3/508** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/0851** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  

- EP 1886792 A2 20080213 - IBIDI GMBH [DE]
- WO 2008149914 A2 20081211 - NIPPON KOGAKU KK [JP], et al
- WO 2005079985 A1 20050901 - IBIDI GMBH [DE], et al
- DE 10148210 A1 20030424 - IBIDI GMBH [DE]
- B. JACOBY ET AL.: "Abscheidung, Charakterisierung und Anwendung von Plasma-Polymerschichten auf HMDSO-Basis", VAKUUM IN FORSCHUNG UND PRAXIS, 2006, pages 12 - 18
- D. HEGEMANN ET AL.: "Deposition Rate and Three-dimensional Uniformity of RF plasma deposited SiO<sub>2</sub> films", SURFACE AND COATING TECHNOLOGY, 2001, pages 849

Citation (search report)  

- [A] US 2010067105 A1 20100318 - EGELER OLIVER [CA], et al
- [A] WO 2008149914 A2 20081211 - NIPPON KOGAKU KK [JP], et al
- [A] EP 0648536 A1 19950419 - EIDGENOESS MUNITIONSFAB THUN [CH]

Cited by  
EP3095517A1

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2604342 A1 20130619; EP 2604342 B1 20140625**; CN 103157524 A 20130619; CN 103157524 B 20160302; DK 2604342 T3 20140901; US 2013171043 A1 20130704; US 9333503 B2 20160510

DOCDB simple family (application)  
**EP 11193029 A 20111212**; CN 201210536279 A 20121212; DK 11193029 T 20111212; US 201213705759 A 20121205